1. 특허정보의 중요성

가. 특허정보의 의의 및 특징

1) 특허정보의 의의

특허권이 발명의 내용에 대한 정보를 일반에 공개하는 대가로 발명자에게 부여되는 독점적 권리라면 특허정보는 특허 제도 상에서 특정 발명에 대해 이러한 권리를 부여하는 과정에서 나타나는 모든 관련 정보를 말한다. 일반적으로 특허정보라 하면 출원인이 특허권을 인정받기 위해서 해당 국가기관에 특허 출원서를 제출하는 출원 행위에서부터 발생되는 모든 문서상 또는 행정상 정보들을 포괄한다.

2) 특허정보의 특징

기업의 지식재산의 창출에 있어서 기업의 연구개발 활동은 매우 중요하다. 연구개발 단계에서는 선행기술조사에 의해 타사의 특허 등의 지식재산권과의 저촉관계를 파악하면서 특허맵 등을 작성함으로써 지식재산의 방향성을 제시할 필요가 있다.
특허정보란 새로운 과학기술 정보를 제공한다는 기술정보적인 기능과 아울러 재산권을 부여하는 법적인 문서라는 기능을 동시에 가진다.
특허의 기술정보적인 기능과 관련하여 포함하여야 할 내용이 법적으로 정해져 있으며 여기에는 발명의 목적(종래기술), 발명의 구성(실시예) 또는 발명의 효과(산업상 이용가능성) 등이 있다.
특허정보는 정보의 형태가 정형화되어 있고 논문과는 달리 모든 분야를 포함하고 있어서 동향 파악이나 기술예측 등 시계열적인 정보분석이 가능하다.

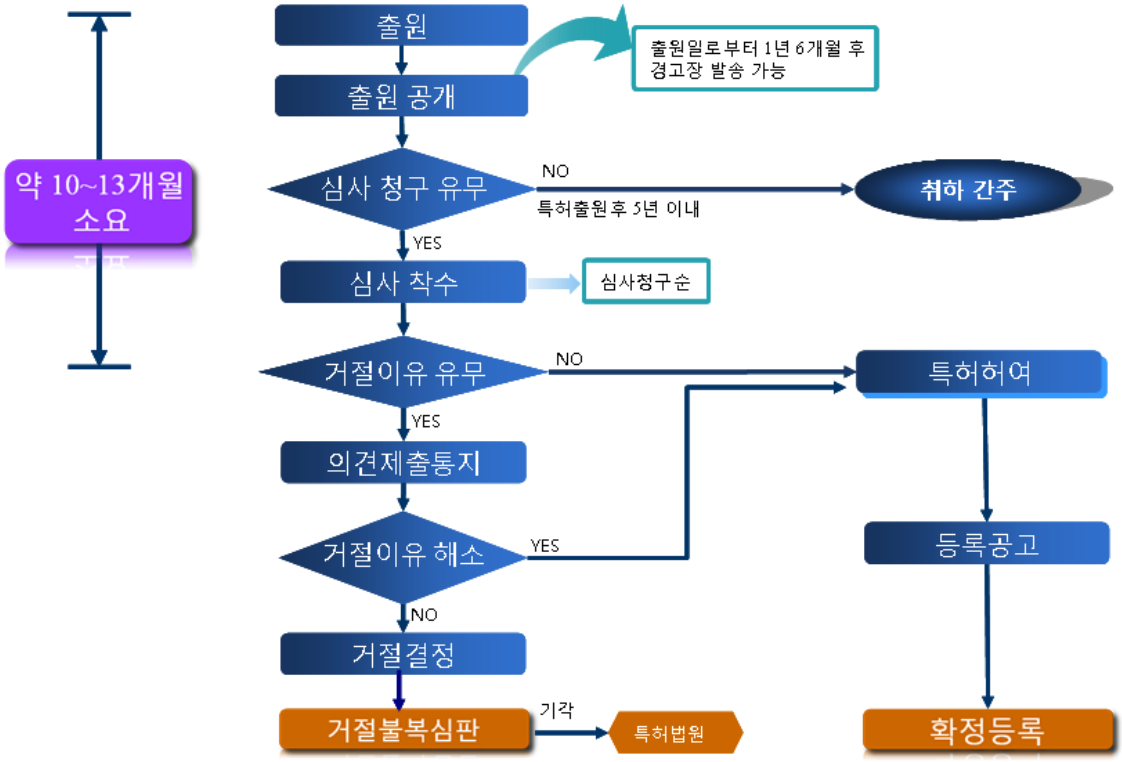
<표 1-1> 특허정보의 특징

구분	발명의 목적	발명의 구성	발명의 효과
내용	- 발명이 속하는 기술분야 - 그 기술분야의 종래기술 - 발명이 이루고자 하는 기술적 과제	- 과제 해결을 위한 기술적 수단 - 기능 및 작용 - 실시예	
연구개발에의 유용성	관련 기술이 어디까지 와 있는지에 대한 동향과 연구 개발 시 부딪치는 문제 해결책 제시	실시예를 통해 학술논문보다 구체적인 데이터 제공 (미국 : 최상의 실시예 요구)	연구성과의 상업적 이용 분야에 대한 아이디어 제공

나. 각국의 특허절차와 특허정보

1) 한국

가) 특허절차



[그림 1-1] 국내 특허출원 절차

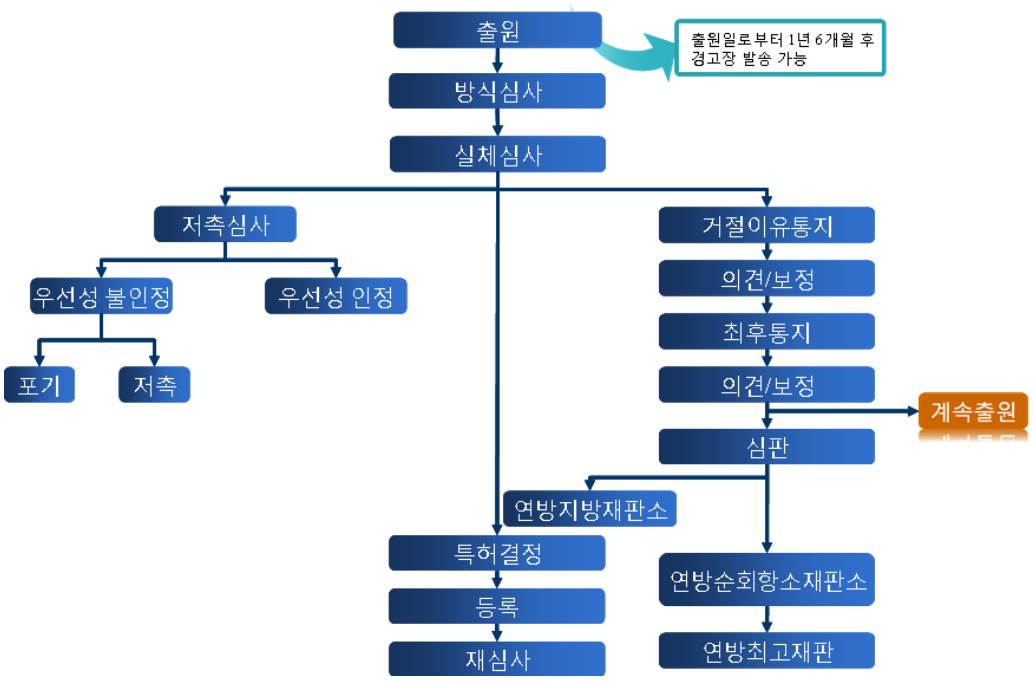
출원된 특허발명은 방식심사와 실체심사를 거쳐 특허요건을 구비한 건에 한하여 등록받을 수 있다.

방식심사란 특허청에 제출한 서류가 특허법 및 관련 법력에 적합한지 여부를 심사하는 것을 말한다. 방식심사에서는 주로 출원서 서식의 필수사항 기재여부, 기간 준수 여부, 증명서 첨부 여부, 수수료 납부 여부 등의 절차상의 흠결을 점검한다. 만약 흠결이 있으면 보정통지서를 보내 흠결을 치유하게 하고 지정된 기간 내에 치유하지 않으면 출원절차를 무효로 할 수 있다.

심사청구제도는 심사 적체에 따른 심사처리 장기화를 방지하기 위한 수단으로 도입되었으며, 심사업무를 경감하기 위하여 모든 출원을 심사하는 대신 출원인이 심사를 청구한 출원에 대해서만 심사하는 제도이다. 최근 2008년 10월1일 부터는 맞춤형 3트랙 특허심사 처리시스템이 도입되어 '빠른 심사', '일반 심사', '늦은 심사'의 세 가지 서비스 중 하나를 자신의 특허전략에 따라 원하는 시기에 특허심사를 받을 수 있게 되었다.

실체심사는 출원된 특허발명을 등록시키는 과정에서 특허요건의 만족여부를 심사하는 것이다. 실체심사에서는 기술을 공개하는 대가로 특허를 부여하는 것이므로 일반인이 기술의 내

나) 특허절차



[그림 1-2] 미국 특허출원절차

미국의 특허출원은 크게 가출원(provisonal application)과 정규출원(non-provisional application)으로 구별된다. 정규출원은 실체심사의 대상이 되며 신규성 및 진보성 등의 특허요건을 갖추어야 특허 등록이 가능하다.
미국은 출원공개제도가 존재하며 2001년 3월 15일 이후부터 출원 공개가 이루어졌다. 여기서, 가출원은 출원 공개의 대상이 아니며, 출원인이 비공개 청구(nonpublication request)를 제출하는 경우 그 출원은 공개되지 않을 수 있다.
따라서 미국 출원은 2001년 3월 15일자 이전인 경우에는 그 시점에서 공개되지 않으므로, 등록된 특허 명세서만을 검색할 수 있으므로, 특허 검색에 한계가 있다.

<TIP> 미국의 출원 공개 제도

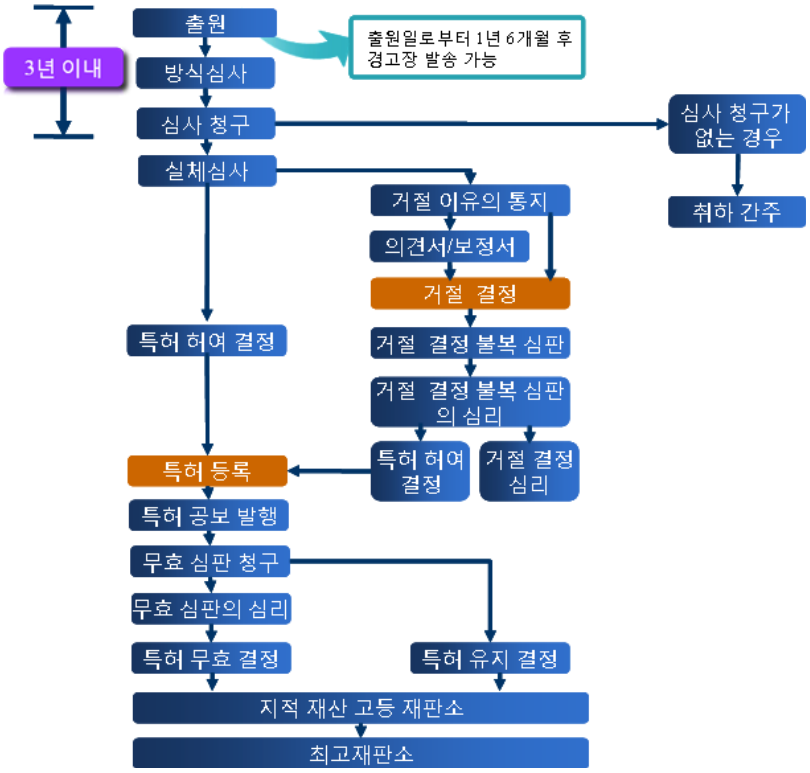
미국 특허출원의 경우 1999년 개정된 발명자보호법에서 출원공개제도가 채택되었으며, 2001년 3월 15일부터 출원공개 되었다. 따라서 미국특허 검색시 이를 유의하여야 한다.

다) 특허정보

미국에서 출원된 특허발명은 최선일 후 18개월 후에 공개되며, 설정등록 후 등록공고된 다. 따라서 출원내용은 공개번호로 등록내용은 등록번호를 이용하여 검색이 가능하다. 여기서, 유의할 사항은 앞 서 설명한 바와 같이, 법적으로 출원 공개된 특허발명은 2000년 11월 일

본[1)]

라) 특허절차



[그림 1-3] 일본 특허출원절차

일본에서 특허를 받기 위해서는 관련 법령에 따른 형식을 갖춘 출원이 있어야 한다. 일본은 선출원주의를 채택하고 있으며, 따라서 발명은 가능한 빨리 출원되어야 한다. 또한 발명이 출원 전 공개되지 않아야 한다.

우선적으로, 출원을 위해 제출된 문서들은 필요한 절차를 갖추었는지, 형식적인 요건들이 만족되는지 심사된다. 만족되지 못할 경우 그러한 상태를 수정할 것이 요청된다.

출원의 내용은 출원일로부터 18개월이 경과된 후 공개공보에 공개된다.

일본 특허의 공개번호는 공개년도에 대해 서기 또는 국왕에 따른 연호를 사용하고, 이후 공개번호 6자리가 순서대로 부여된다. 일본 특허의 공개번호는 예를 들면, 2005-786321 또는 H17-786321로 표시될 수 있다. 여기서, H는 연호인 平成(헤이세이)의 약어이다. 平成(헤이세이) 이전의 일본 연호는 昭和(쇼오와)이며, 昭和(쇼오와) 1년은 1925년이므로, 昭和(쇼오와) 년도에 25를 더하면 서기로 표현할 수 있다. 예를 들면, 昭和(쇼오와) 55년은 25를 더하면 서기 1980년이다.

1) 일본특허청 사이트 www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_gaiyou/tokkyo1.htm